

# Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体的生长及其性能 \*

张继军<sup>†</sup> 介万奇

(西北工业大学材料学院, 西安 710072)

**摘要:** 通过适当的工艺措施, 采用传统布里奇曼法生长了尺寸为  $\Phi 30\text{mm} \times 120\text{mm}$  的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体。对晶体进行了 X 射线粉末衍射、X 射线双晶摇摆曲线、紫外-可见光光谱、红外透过率及电阻率测试。测试结果表明, 晶体结构为立方型, 半峰宽较低, 吸收边为 720nm, 对应禁带宽度为 1.722eV, 晶体的红外透过率和电阻率都较高。并讨论了晶体中的缺陷对红外透过率和电阻率的影响。

**关键词:** Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te; X 射线衍射; 红外透过率; 电阻率; 紫外-可见-近红外光光谱

**PACC:** 0765G; 0785; 8110F

中图分类号: TN304.2<sup>+</sup> 6

文献标识码: A

文章编号: 0253-4177(2006)06-1026-04

## 1 引言

Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 材料是一种稀释磁性半导体材料 (diluted magnetic semiconductors, DMS)。在该材料中, 具有磁性的 Mn<sup>2+</sup> 部分无序代替了 CdTe 中的 Cd<sup>2+</sup>。由于 Mn<sup>2+</sup> 与导带电子或价带空穴的自旋交换作用, 使其具有一些独特的磁学和磁光性质, 其中包括巨负磁阻效应、巨法拉第磁旋效应、正电荷有效 g 因子增长、强的圆偏振带边发光、自旋玻璃转变等<sup>[1]</sup>。利用这些性质可以制作光电子器件和磁光器件。

同时, Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 材料也可被选择用来作为外延生长 Hg 基合金(如 HgCdTe, HgZnTe)的衬底材料, 它的优势体现在:(1) 在固溶度  $x = 0 \sim 0.75$  范围内, 固溶体 Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 均形成闪锌矿结构;(2) 改变固溶度  $x$  值, 可方便地改变 Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 材料的能隙、晶格常数、电子和空穴的有效质量等。该化合物的晶格常数  $a$  可根据等式:  $a(\text{nm}) = 0.6482 - 0.0150x_{\text{Mn}}$  在 0.637~0.648nm 范围内选择;(3) 在 CdTe-MnTe 伪二元相图中, 固液两相区很窄, 表明 Mn 的分凝系数接近 1, 易于采用传统的生长方法获得组分均匀的单晶<sup>[2]</sup>。

Trivedi 等人<sup>[3]</sup> 指出只有利用布里奇曼法 (Bridgman 法) 才能从熔体中生长出单晶性能好的 Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 晶体, 并利用这种方法生长出了直径达到 20mm 的 Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 单晶。但是生长直径更大、组分均匀的 Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 晶体目前尚未见报道。其中主要原因有:(1) Mn 的活性大, 在高温下容易侵蚀石英坩埚, 使坩埚产生粘舟现象, 造成坩埚的

破裂;(2) 从 CdTe-MnTe 伪二元相图中可以看到, 在晶体降温过程中存在固态相变, 固态相变容易引发孪晶。本文采用垂直 Bridgman 法, 通过适当的工艺降低以上两方面的影响, 生长出了尺寸为  $\Phi 30\text{mm} \times 120\text{mm}$  的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体。并通过 X 射线衍射测定晶体的结构和结晶质量; 同时测试了晶体的红外透过率、紫外-可见光光谱、电阻率。这为进一步深入地研究该晶体材料的光学、电学等特性以及器件应用打下了良好的基础。

## 2 晶体生长

晶体生长采用的原材料 Cd, Te 纯度达到 7N, Mn 的纯度为 5N, 所选用于制造坩埚的石英纯度在 6N 以上, 坩埚内径  $\Phi 30\text{mm}$ 。由于 Mn 的活性大, 在高温下容易侵蚀石英坩埚, 所以装料前在石英坩埚内表面镀了一层致密的碳膜。将密封的原材料 Cd, Te 和 Mn 在百级超净间内打开, 严格按照化学计量比称量(精确到  $10^{-4}\text{g}$ ), 然后装入镀有碳膜的石英坩埚中, 并在高真空( $1.33 \times 10^{-4}\text{Pa}$ )下进行真空封装。封好的原料在 1393K 的均匀温度场摇摆炉中合成为 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 多晶, 然后在本实验室研制的 ACRT-II 型两温区晶体生长炉中采用 Bridgman 法进行生长。在生长过程中, 使坩埚尖端以 1mm/h 的速度匀速下降, 经过 10K/cm 的温度梯度区后进入低温区。经过多晶生长淘汰, 在坩埚尖端部分变为单晶。晶体的轴向生长取向为 [110]。长晶完成后, 使长晶炉上下温区温度快速降到固态相变温度以下即 1173K, 并在此温度下对晶锭进行长时间的原位退火。最后生长出的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶锭尺寸为  $\Phi 30\text{mm} \times 120\text{mm}$ , 其照片如图 1 所示。

\* 国家自然科学基金资助项目(批准号: 50336040)

† 通信作者。Email: zhangjijun222@yahoo.com

2005-09-04 收到, 2006-01-24 定稿

图 1 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶锭照片Fig. 1 Photograph of Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te ingot

对长出的晶锭用细砂纸打磨显示晶粒, 最终看到晶锭的成晶率达到了 60% 以上, 并定向切割得到了最大单晶面积为 20mm×20mm 的(111)面晶片.

### 3 晶体的测试与分析

对从坩埚中取出的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶锭进行定向切割, 沿(111)面切割成厚度为 1.5mm、面积为 10mm×10mm 的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 单晶片, 并对晶片进行机械磨抛和 5% Br<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>OH 腐蚀液中的化学抛光. 晶片最终厚度为 1.2mm. 然后测试晶体的结晶质量以及光学、电学性能.

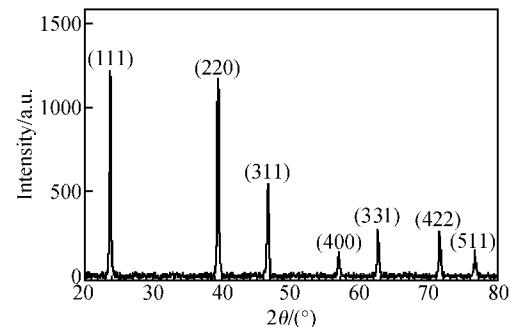
#### 3.1 晶体的结构测试

采用 X 射线粉末衍射方法测定 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体的结构. 粉末衍射要求晶体样品取向随机分布, 在任何方向上都有足够的可供测量的结晶颗粒. 因此, 本实验中从结晶质量相对较好的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶锭的中间部分取一小块样品晶体, 锉成细粉后装填在特定样品板的凹槽内, 用平整光滑的玻璃板适当压紧, 获得待测定平整样品. 然后采用帕纳科公司的 X'Pert Pro 多功能 X 射线衍射仪对样品进行 X 射线粉末衍射测试, 得出 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体的 X 射线衍射图和衍射指数标准化表, 分别如图 2 和表 1 所示.

表 1 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 的 X 射线衍射谱标定数据表Table 1 Rating data of Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te X-ray diffraction spectrum

序号	$2\theta/(\text{°})$	$d_i/\text{nm}$	$N_i/N_1$	$3N_i/N_1$	$hkl$	$a/\text{nm}$
1	23.8523	0.372745	1	3	111	0.6456127
2	39.4511	0.228221	2.66755	8	220	0.6455052
3	46.6288	0.194625	3.66798	11	311	0.6454987
4	57.0299	0.161353	5.33666	16	400	0.6454103
5	62.6927	0.148071	6.337	19	331	0.6454256
6	71.5613	0.131743	8.00513	24	422	0.6454062
7	76.6576	0.124204	9.00643	27	511/333	0.6453839

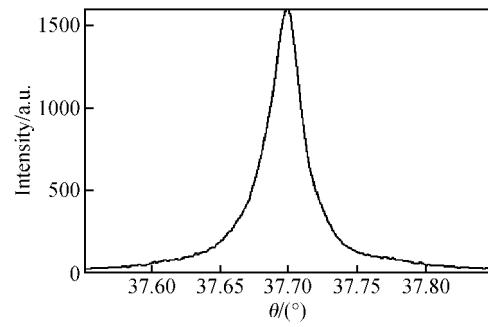
$$\text{注: } N_i/N_1 = d_i^2/d_1^2 = \sin^2\theta_i/\sin^2\theta_1.$$

图 2 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体的 X 射线衍射谱Fig. 2 X-ray diffraction spectrum of Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te crystal

由表 1 中的数据可知, Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体的结构为立方型<sup>[4]</sup>, 晶格常数为  $a \approx 0.6454\text{ nm}$ .

#### 3.2 晶体的结晶质量测试

晶体的结晶质量采用 X 射线双晶摇摆曲线来表征. 晶体内的残余应力、位错、孪晶等都会对 X 射线衍射回摆曲线的结果产生影响, 使峰高变小, 峰形变宽. 并且, 一般认为, X 射线衍射回摆曲线峰的对称性与晶体的结构均匀性直接相关, 峰型左右对称, 说明在衍射面积内晶体的成分和结构比较均匀. 因此, 这种表征手段是对晶体的整体结晶质量的一个综合评价. 本实验采用帕纳科公司的 X'Pert Pro 多功能 X 射线衍射仪测试 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶片(111)面的双晶摇摆曲线, 结果如图 3 所示. 从实验可以看出, 该晶片的衍射峰位于  $\theta = 37.6991^\circ$ , 半峰宽(FWHM)仅为 69.12'', 峰型尖锐, 对称性良好. 半峰宽小于 Guergouri 等人<sup>[5]</sup>采用垂直布里奇曼法生长的 CdTe 和 Cd<sub>0.9</sub>Mn<sub>0.1</sub>Te 晶体. 该结果表明, Cd<sub>0.8</sub>-Mn<sub>0.2</sub>Te 晶片的结晶质量良好.

图 3 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶片(111)面 X 射线双晶摇摆曲线Fig. 3 Double crystal X-ray diffraction of the (111) face of Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te crystal wafer

#### 3.3 晶体的电阻率测试

电阻率是晶体最重要的电学参数之一. 为了使

$\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$  晶体应用于器件, 必须了解和控制该晶体的电学性能。在经过化学抛光后的  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  样品晶片的两面镀上 Au 膜, 以此作为接触电极, 采用 Agilent 4155 CVIV 测试仪测试了晶体的伏安特性。测试是在室温、暗场下进行, 这样光生载流子就可以忽略, 所用电压范围为 0~20V, 采用依次扫描法, 扫描点为 101 个, 得到测试结果如图 4 所示。图中, 电流和电压基本上是线性关系, 可见 Au 膜电极与晶片的接触为良好的欧姆接触。由曲线经拟合计算得出: 室温、暗场条件下,  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶片的电阻率为  $1.4 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ , 高于不同文献中<sup>[1,6]</sup>所报道的生长  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶片的电阻率。

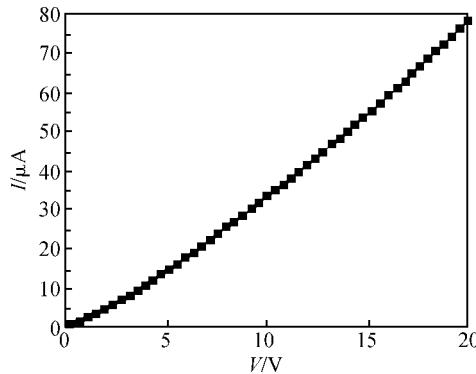


图 4  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  样品的  $I$ - $V$  特性

Fig. 4  $I$ - $V$  characteristics for  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  sample

一般认为影响晶体电阻率的主要原因包括晶体中的杂质浓度、Cd 空位以及位错密度<sup>[7]</sup>。原材料中不可避免存在杂质, 杂质会在晶体中形成一系列杂质能级, 降低晶体的禁带宽度, 从而降低晶体的电阻率。同时, 采用熔体法生长  $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$  晶体时, 由于 Cd 的蒸汽压较高, 一部分 Cd 会从熔体中挥发, 使晶体中产生 Cd 空位, 过量的 Cd 空位显著提高了晶体的载流子浓度, 降低了晶体的电阻率。Becla 等人<sup>[1]</sup>采用 600°C 温度、饱和 Cd 气氛下对  $0.1 \leq x \leq 0.3$  的  $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$  晶片进行退火, 发现退火后晶片的电阻率提高了 2 个数量级。其主要原因是 Cd 气氛下退火减少了晶体中的 Cd 空位和杂质。由此可推测实验生长出的  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶体中的杂质和 Cd 空位较少。

#### 3.4 晶体的红外透过测试

晶片红外透过率的测定采用美国 Nicolet 公司 Nexus 型傅里叶变换红外光谱仪, 测试波数范围为  $4000\sim500\text{cm}^{-1}$ , 扫描次数为 16 次, 测试曲线如图 5 所示。在测试波数范围内测得  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶体的平均红外透过率为 72.9%, 透过曲线比较平整。而前人报道的生长  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶体的红外透过率在 60% 左右。相比而言, 本实验室生长的  $\text{Cd}_{0.8}$

$\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶体红外透过率较高。Magee 等人<sup>[8]</sup>认为  $\text{CdTe}$  的红外透过率与位错、Te 沉淀、空位环、堆垛层错等相关。这些结构缺陷也可能影响  $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$  中缺陷对红外透过率的影响还需要进行进一步的研究。

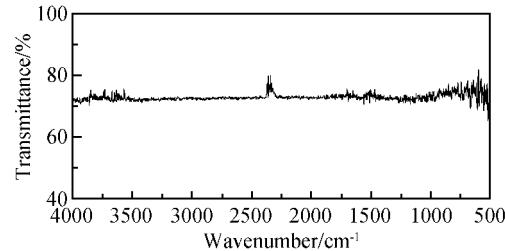


图 5  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶片的红外透过光谱

Fig. 5 IR transmittance spectrum of  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  crystal wafer

#### 3.5 晶体的紫外-可见-近红外光光谱测试

室温下的紫外-可见光透过光谱可以反映组分不同的  $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$  晶体的吸收边变化。我们采用岛津 UV-3150 紫外-可见-近红外光光谱仪, 室温下测试了  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶片在波长范围为 250~2500nm 内的紫外-可见-近红外光透过光谱, 结果如图 6 所示。从图中可以看到在波长大于 720nm 后,  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶体的透过率达到了 70%, 曲线比较平缓, 而对 720nm 波长以下的光基本不透过。由此得到  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶体的吸收边为 720nm, 并可算出对应的禁带宽度  $E_g$  为 1.722eV。利用 Abreu 等人<sup>[9]</sup>在室温下对  $0 < x_{\text{Mn}} < 0.3$  的  $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$  晶体测得的光学吸收数据, Becla 等人<sup>[1]</sup>线性拟合出了光吸收边位置能量  $E_{g0}$  和锰含量  $x_{\text{Mn}}$  的一个经验公式:

$$x = [E_{g0}(\text{eV}) - 1.462]/1.435 \quad (1)$$

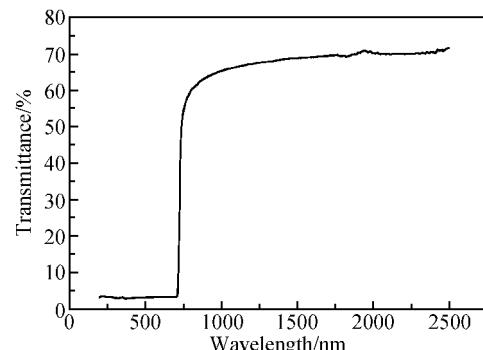


图 6  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  晶片的紫外-可见-近红外光透过光谱

Fig. 6 Ultraviolet-visible-near-infrared transmittance spectrum of  $\text{Cd}_{0.8}\text{Mn}_{0.2}\text{Te}$  crystal wafer

采用该公式可以得出 Mn 含量的值。将实验结果通过该公式算得本试验室生长的 Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te 的 Mn 含量  $x = 0.181$ , 与理论值相差 0.019, 相差在实验误差 3% 范围内。

## 4 结论

(1) 采用传统布里奇曼法, 通过合适的工艺措施, 生长出了直径达到  $\Phi 30\text{mm}$ , 长度为 120mm 的 Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te 晶体。

(2) 测得该晶体的结构为立方型, 晶格常数为 0.6454nm; 半峰宽(FWHM) 仅为 69.12'', 表明晶体结晶质量良好; 晶体的吸收边为 720nm, 对应禁带宽度为 1.722eV; 在波数范围为 4000~500cm<sup>-1</sup> 内, 晶体的平均红外透过率为 72.9%; 并测得 Cd<sub>0.8</sub>-Mn<sub>0.2</sub>Te 晶片的电阻率为  $1.4 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

## 参考文献

- [1] Becla P, Kaiser D, Giles N C, et al. Electrical and optical properties of P-and As-doped Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te. *J Appl Phys*, 1987, 62:1352
- [2] Triboulet R, Heurtel A, Rioux J, et al. Twin-free (Cd, Mn)-Te substrates. *J Cryst Growth*, 1990, 101:131
- [3] Trivedi S B, Jagannathan G V, Kucher S W, et al. Development of novel, band-gap engineered photorefractive semiconductors CdMnTe: V for real time optical processing. Final Technical Report, 1998:104
- [4] Ma Shiliang. X-ray diffraction of metal. Xi'an: Northwestern Polytechnical University Press, 1997 (in Chinese) [马世良. 金属 X 射线衍射学. 西安: 西北工业大学出版社, 1997]
- [5] Guergouri K, Ferah M S, Triboulet R, et al. Study of the crystalline quality of CdTe, CdZnTe and CdMnTe substrates used for liquid phase epitaxy of Cd<sub>0.7</sub>Hg<sub>0.3</sub>Te. *J Cryst Growth*, 1994, 139:6
- [6] Stankiewicz J, Aray A. Electrical properties of p-type Mn<sub>x</sub>Cd<sub>1-x</sub>Te crystals. *J Appl Phys*, 1982, 53(4):3117
- [7] Linskens A, Hekkert S T L, Reuss J. One and two photon spectra of SF<sub>6</sub> molecular beam measurements. *Infrared Phys*, 1991, 32:259
- [8] Magee T J, Peng J, Bean J. Microscopic defects and infrared absorption in cadmium telluride. *Phys Status Solidi A*, 1975, 27:557
- [9] Abreu R A, Giriat W, Vecchi M P, et al. Temperature dependence of the absorption edge in Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te. *Phys Lett*, 1981, 85A:399

## Growth and Properties of Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te Crystal\*

Zhang Jijun<sup>†</sup> and Jie Wanqi

(College of Material Science and Engineering, Northwest Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

**Abstract:** By optimizing growth parameters, a vertical Bridgman method is successfully used to grow a Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te crystal with a size of  $\Phi 30\text{mm} \times 120\text{mm}$ . The as-grown crystal is characterized by X-ray powder diffractometer, X-ray double-crystal diffractometer, ultraviolet visible-near infrared spectrum, and IR transmittance and resistivity measurements. The results show that the as-grown crystal has a cubic structure with lattice constant  $a \approx 0.6454\text{nm}$ , and its absorption edge is 720nm, corresponding to the band gap of 1.722eV. The results also show high crystallinity, high IR transmittance, and high resistivity. The effect of crystal defects on the IR transmittance and resistivity is discussed.

**Key words:** Cd<sub>0.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>Te; X-ray diffraction; infrared transmittance; resistivity; ultraviolet visible-near infrared spectrum  
**PACC:** 0765G; 0785; 8110F

**Article ID:** 0253-4177(2006)06-1026-04

\* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 50336040)

† Corresponding author. Email: zhangjijun222@yahoo.com

Received 4 September 2005, revised manuscript received 24 January 2006

©2006 Chinese Institute of Electronics